

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. September 2005 (15.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/085129 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **C01B 31/00**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2005/001281**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
9. Februar 2005 (09.02.2005)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
04005421.5 8. März 2004 (08.03.2004) **EP**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **SOLVAY FLUOR GMBH [DE/DE]**; Hans-Böckler-  
Allee 20, 30173 Hannover (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **BRAUN, Max**  
[DE/DE]; Varloh 8, 30900 Wedemark (DE). **EICHER, Jo-**  
**hannes** [DE/DE]; Im Bosenkamp 24a, 31319 Sehnde-Ilten  
(DE).

(74) Anwalt: **FISCHER, Reiner**; c/o Solvay Fluor GmbH,  
Hans-Böckler-Allee 20, 30173 Hannover (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): **AE, AG, AL,**  
**AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,**  
**CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,**  
**FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,**  
**KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,**  
**MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,**  
**PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ,**  
**TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,**  
**ZM, ZW.**

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): **ARIPO (BW,**  
**GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,**  
**ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,**  
**TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,**  
**EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,**  
**PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,**  
**CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).**

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-  
öffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-  
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-  
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der  
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: **PRODUCTION OF CARBONYL FLUORIDE**

(54) Bezeichnung: **HERSTELLUNG VON CARBONYLFLUORID**

(57) Abstract: Carbonyl fluoride which can be used as an etching gas, produced by photochemical oxidation of chlorodifluoromethane or trifluoromethane with light, preferably light having a wavelength of  $\geq 280$  nm in the presence of chlorine.

(57) Zusammenfassung: Carbonylfluorid, das auch als Ätzgas verwendet werden kann, lässt sich durch photochemische Oxidation von Chlordifluormethan oder Trifluormethan mit Licht, beispielsweise mit Licht einer Wellenlänge  $\geq 280$  nm in Anwesenheit von Chlor herstellen.

WO 2005/085129 A2